

Ni、Cr、W、Ti、Al等、  
多種金属対応のハイスペックモデル  
High spec model for Ni, Cr, W, Ti,  
Al target etc.

## COMPACT MULTI COATER

### <Features>

- 真空計を装備し、成膜条件の再現性を確保  
Securing reproduction of thin film forming  
condition with vacuum gauge.
- スモール、コンパクト&ハイスペック  
Small, Compact with High Spec.
- 手動式シャッターの装着が可能(オプション)  
Manual Shutter can be equipped (option).



- タングステンコートが可能のため、高分解能SEM用試  
料作製にも利用可  
Suitable for sample preparation of high  
resolution SEM by tungsten coating.

DESK TOP QUICK COATER

SC-701Mk II  
ADVANCE



## SC-701MKII ADVANCE 仕様 (SPECIFICATIONS)

ターゲットサイズ	φ49mm / t0.5mm(Max)
適用可能ターゲット	Au/Pt/Au-Pd/Pt-Pd/Ag/Pd/W/Ni/Mo/Cr/Ti/Al
試料サイズ	φ50mm(Max)
T-S間調節範囲	20mm/30mm/40mm
排気操作	手動式
スパッタ方式	DCマグネトロン/平行平板型
到達圧力	1Pa以下
圧力測定	ピラニー真空計
圧力制御	ニードルバルブ 導入口径外径φ6mm ワンタッチ継手
プロセス時間	最大15min
プロセスガス	Arガス(導入圧力: 0.1MPa以下)
チャンバーサイズ	φ90×D90mm (SUS製)
排気装置	直結型ロータリーポンプ 20L/min(自動リーク付)
所要電源	単相100V±10% 10A 50/60Hz
寸法・重量	本体: 200(W)×450(D)×290(H) mm, 9kg RP: 295.5(W)×156(D)×199.5(H) mm, 9kg
使用環境	温度: 20°C±5°C 湿度: 75%RH以下(結露なきこと)

※本仕様は、性能改善のため予告なしに変更されることがあります。

Target size	φ49mm / t0.5mm(Max)
Target	Au/Pt/Au-Pd/Pt-Pd/Ag/Pd/W/Ni/Mo/Cr/Ti/Al
Sample size	φ50mm(Max)
T-S adjustment range	20mm/30mm/40mm
Evacuation operation	Manual
Sputtering system	DC Magnetron / Parallel-plate type
Ultimate pressure	1Pa or less
Pressure measurement	Pirani gauge
Pressure regulation	Needle valve Inlet size φ6mm
Process time	Max. 15min
Process gas	Ar gas (Pressure : 0.1MPa or less)
Chamber size	φ90×D90mm (SUS)
Rotary pump	Directly-connected rotary pump 20L/min(with automatic leaking system)
Power requirement	Single phase 100V±10% 10A 50/60Hz
Dimensions and weight	Main unit : 200(W)×450(D)×290(H) mm, 9kg RP : 295.5(W)×156(D)×199.5(H) mm, 9kg
Operating environment	Temperature: 20°C±5°C Humidity: 75%RH or less

※These specifications may be changed without prior notice for the sake of improvement.

## 営業品目 / Lines of Business

### ■真空応用機器

- スパッタ装置  
Desk Top Quick Coater (2~8インチ用)  
RF/DCスパッタ装置
- 真空蒸着装置  
抵抗加熱タイプ  
EBタイプ
- 真空排気装置

### ■電子顕微鏡関連機器

- 小型電子線描画装置
- 電子線描画用パターン発生装置
- EBIC計測システム
- 3次元計測装置
- 立体画像観察装置 3D-SEM®
- 高精細画像取込装置
- SEM用特殊ステージ  
試料加熱/引張試験ステージ  
描画用モーターステージ etc.
- SEM/TEM用マニピュレータ

### ■その他、各種関連機器の試作・開発・製造・販売

### ■Vacuum applied equipment

- Sputter coater  
Desk Top Quick Coater (2~8inch)  
RF/DC Sputtering equipment
- Vacuum evaporation equipment  
Thermal resistance type  
Electron beam type
- Vacuum pumping down equipment

### ■Electron microscopic equipment

- Mini EB lithography system
- Pattern generator for EB lithography
- EBIC measurement system
- 3 dimensional measurement device
- Stereo image observation device 3D-SEM®
- High resolution image capturing system
- Special stage for SEM  
Heating & tensile testing stage  
Motor stage for EB lithography etc.
- Manipulator for SEM/TEM

### ■Prototyping, development, manufacturing and sales of a variety of related equipment



このカタログは  
古紙配合率100%  
再生紙を使用しています。



このカタログは  
植物油インキで  
印刷しています。

サンヨー電子株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-6  
TEL.03-3363-3551 FAX.03-3364-2892  
URL : http://www.sanyu-electron.co.jp

SANYU ELECTRON CO., LTD.

1-22-6, HYAKUNIN-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO, 169-0073, JAPAN  
TEL.81-3-3363-3551 FAX.81-3-3364-2892  
URL : http://www.sanyu-electron.co.jp